

# ?批SSrTiO<sub>3</sub>之傳輸特性研究

李志晃、宋皇輝

E-mail: 9607884@mail.dyu.edu.tw

## 摘要

本實驗研究以固態燒結法燒結摻鈦酸鋨之塊材( $Sr_{1-x}La_xTiO_3 = 0.02 \sim 0.3$ )與雙靶離軸射頻磁控濺鍍磊晶成長摻鈦酸鋨薄膜( $Sr_{1-x}La_xTiO_3 x = 0.067 \sim 0.165$ )於p-type Si(100)、SrTiO<sub>3</sub>(100)基座上。在實驗過程中我們預期塊材與薄膜中之Sr<sup>2+</sup>離子會被La<sup>3+</sup>離子所取代，而造成電子的傳輸行為，進而使摻鈦酸鋨塊材與薄膜具有導電性，經氫/氬混合氣退火後塊材與薄膜樣品始有導電性，由電阻率對溫度關係、霍爾效應等量測觀察其電子傳輸行為，發現薄膜樣品其行為並不適用自由電子氣體模型，而較接近電子相關系統(electron correlation systems)。

關鍵詞：?鈦酸鋨、電子相關系統

## 目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書 . . . . .	iii 中文摘要 . . . . .
iv 英文摘要 . . . . .	v 誌謝 . . . . . vi
目錄 . . . . .	vii 圖目錄 . . . . . x 表目錄 .
獻回顧 . . . . .	xiv 第一章 緒論 1.1研究背景 . . . . . 11.2文
測原理 2.1電阻率量測 . . . . .	2.1.3論文架構 . . . . . 12 2.2.1 Van Der Pauw電阻率量測原理 . . . . . 12
2.1.2四點量測原理 . . . . .	2.2.2霍爾量測原理 . . . . . 14 2.3 X-ray
繞射原理 . . . . .	2.2.4膜厚量測原理 . . . . . 18 2.5熱電原理 . . . . .
繞射原理 . . . . .	17 2.5.1熱電現象 . . . . . 19 2.5.2 Seebeck效應 . . . . .
繞射原理 . . . . .	20 2.5.3 Peltier效應 . . . . . 21 2.5.4 Thomson效應 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	22 2.5.5熱傳導係數與Seebeck係數量測原理 . . . . . 23 第三章 樣品製備與量測 3.1樣品製備 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	25 3.2塊材製備 . . . . . 25 3.2.1實驗流程 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	26 3.2.2實驗流程敘述 . . . . . 27 3.3薄膜製備 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	32 3.3.1實驗流程 . . . . . 33 3.3.2實驗流程敘述 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	34 3.4定性與定量量測 . . . . . 36 3.4.1 X-ray繞射分析儀 . . . . . 36 3.4.2
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	37 3.4.3成份分析儀(EDS) . . . . . 38 3.5電性量測 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	39 3.5.1塊材電阻率量測 . . . . . 39 3.5.2薄膜電阻率量測 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	43 3.5.3霍爾量測 . . . . . 44 第四章 結果與討論 4.1塊材樣品結構與成分分析 . . . . . 47 4.1.1塊材(Bulk)X-ray繞射分析 . . . . . 47 4.1.2塊材(Bulk) EDS成份分析 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	50 4.2薄膜樣品之成長參數與結構、成份分析 . . . . . 51 4.3塊材與薄膜樣品之傳輸特性 . . . . .
掃描式電子顯微鏡(SEM) . . . . .	58 4.3.1塊材樣品之傳輸特性 . . . . . 59 4.3.2薄膜樣品之傳輸特性 . . . . .
參考文獻 . . . . .	65 4.4塊材樣品之熱電特性 . . . . . 72 第五章 結論 . . . . . 77
參考文獻 . . . . .	78

## 參考文獻

- [1]吳介帆，“電控式超導濾波器之製作暨特性研究”，大葉大學碩士論文，2005。
- [2] Haruhiko OBARA, Atsushi YAMAMOTO, Chul-Ho LEE, Keizo KOBAYASHI1, Akihiro MATSUMOTO1 and Ryoji FUNAHASHI2, J. J. Appl. Phys. 43, L540 ~ L542.
- [3] Hiroaki Muta, Ken Kurosaki, Shinsuke Yamanaka, Journal of Alloys and Compounds (2005) 392 ~ 309.
- [4] Shingo Ohta, , Takashi Nomura, Hiromichi Ohta, Hideo Hosono, Kunihiro Koumoto, Appl. Phys. Lett. 87 092108 (2005).
- [5] J. F. Schooley, W. R. Hosler, E. Ambler, J. H. Becker, M. L. Cohen, and C.S. Koonce, Phys. Rev. Lett. 14, 305 ~ 1965.
- [6] A. Baratoff and G. Binnig, Physica B 108, 1335 ~ 1981.
- [7] E. R. Pfeiffer and J. F. Schooley, Phys. Lett. A 29, 589 ~ 1969.
- [8] H. Suzuki, H. Bando, Y. Ootuka, I. H. Inoue, T. Yamamoto, K. Takahashi, and Y. Nishihara, J. Phys. Soc. Jpn. 65, 1529 ~ 1996.

- [9] J. F. Schooley, W. R. Hosler, and M. L. Cohen, Phys. Rev. Lett. 12, 474 ~ 1964.
- [10] M. Higuchi, K. Aizawa, K. Yamaya, K. Kodaira, J. Solid-State Chem. 92 (1991) 573 ~ 577.
- [11] T. Okuda, K. Nakanishi, S. Miyasaka, and Y. Tokura, Phys. Rev. B 63, 113104 (2001).
- [12] R. Moos, K.H. Hardtl, J. Appl. Phys. 8081 (1996) 393 ~400.
- [13] Ralf Moos, Alain Gnudi, and Karl Heinz Hkdtl, J. Appl. Phys. 78, 5042 (1995).
- [14] Shingo Ohta, Takashi Nomura, Hiromichi Ohta, Kunihiro Koumoto, J. Appl. Phys. 97, 034106 (2005).
- [15] S. Hashimoto, L. Kindermann, F.W. Poulsen, M. Mogensen, Journal of Alloys and Compounds 397 (2005) 245-249.
- [16] David Olaya, Feng Pan, Charles T. Rogers, and John C. Price, Appl. Phys. Lett. 80 (2002) 2928 ~ 2930.
- [17] K. O. Grosse-Holz, J. F. M. Cillessen, R. Waser, Applied Surface Science 96-98 (1996) 784-790.
- [18] Shingo Ohta<sup>1</sup>, Takashi Nomura<sup>1</sup>, Hiromichi Ohta<sup>1,2,3</sup>, Masahiro Hirano<sup>3</sup>, Hideo Hosono<sup>3,4</sup> and Kunihiro Koumoto<sup>1,2</sup>, IEEE 168 ~ 2005.
- [19] Hiroaki Muta, Ken Kuroaki, Shinsuke Yamanaka, Journal of Alloys and Compounds 392 (2005) 306 ~ 309.
- [20] O. A. Marina, N. L. Canfield, J. W. Stevenson, Solid State Ionics 149 (2002) 21-28.
- [21] S. Hashimoto, F. W. Poulsen, M. Mogensen, Journal of Alloys and Compounds 397 (2006) 245 ~ 249.
- [22]美國國家標準和技術院(National Institute for Standards and Technology, NIST) [23]陳徽中 "形狀記憶合金Ni<sub>2+x</sub>Mn<sub>1-x</sub>Ga之熱電傳輸性質研究", 東華大學碩士論文, 2005 [24]李岳勳, "異價添加劑對8YSZ離子導體與SrTiO<sub>3</sub>半導體其晶體結構與導電性質之影響", 成功大學碩士論文, 2000.
- [25] Y. Tokura, Y. Taguchi, Y. Fujishima, and T. Arima, Phys. Rev. Letts. 70, 2126-2129 ~ 1993.